

中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

统一社会信用代码 91310115710939629R
中国上海市中国(上海)自由贸易试验区张江路 18 号

**GB/T 23331-2012/
ISO 50001:2011
RB/T 101-2013**

版本号 2



获证组织能效指标及能耗核算边界

审核类型及时间	审核周期内单位产品/产值能耗	能耗核算边界
初次审核 2019年1月7日-1月9日	2017年1月-2017年12月: 0.08249 吨标准煤/万元 1.386 吨标准煤/平方米 2018年1月-2018年11月: 0.09440 吨标准煤/万元 1.383 吨标准煤/平方米	边界: 位于中国上海市浦东新区张江路 18 号的工厂(不包括绍兴项目、江阴项目和凸版项目), 主要用能过程包括清洗、氧化扩散、CVD 沉积、光刻、去胶、干法刻蚀、CMP 抛光、湿法腐蚀、离子注入、溅射、检测等生产过程以及锅炉、压缩空气制取、排风照明、中央空调、工艺冷却水、纯水制取、废水处理和废气处理等辅助生产过程以及食堂等附属过程 2017年1月-2017年12月: 59667.4104 平方米(等效 8 英寸晶圆) 2018年1月-2018年11月 53990.416 平方米(等效 8 英寸晶圆)
第 1 次监督 2020年1月6-7日	2018年12月-2019年11月 0.101 吨标准煤/万元 1.425 吨标准煤/平方米	边界: 位于中国上海市中国(上海)自由贸易试验区张江路 18 号的工厂(不包括绍兴项目、江阴项目和凸版项目), 主要用能过程包括清洗、氧化扩散、CVD 沉积、光刻、去胶、干法刻蚀、CMP 抛光、湿法腐蚀、离子注入、溅射、检测等生产过程以及锅炉、压缩空气制取、排风照明、中央空调、工艺冷却水、纯水制取、废水处理和废气处理等辅助生产过程以及食堂等附属过程。 2018年12月-2019年11月 52537.460 平方米(等效 8 英寸晶圆)
第 2 次监督 2021年3月18-19日	2019年12月-2020年12月 0.107 吨标准煤/万元 1.409 吨标准煤/平方米	边界: 位于中国上海市中国(上海)自由贸易试验区张江路 18 号的工厂(不包括绍兴项目、江阴项目和凸版项目), 主要用能过程包括清洗、氧化扩散、CVD 沉积、光刻、去胶、干法刻蚀、CMP 抛光、湿法腐蚀、离子注入、溅射、检测等生产过程以及锅炉、压缩空气制取、排风照明、中央空调、工艺冷却水、纯水制取、废水处理和废气处理等辅助生产过程以及食堂等附属过程。 2019年12月-2020年12月 53008 平方米(等效 8 英寸晶圆)

第 1 页 共 1 页

Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation

Unified Social Credit Code 91310115710939629R
 No. 18, Zhangjiang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai City, P.R. China

**GB/T 23331-2012/
 ISO 50001:2011
 RB/T 101-2013**

Issue 2



Organization's energy performance indicators and boundaries

Audit type and date	Energy consumption per unit product or unit output value during audit cycle	Boundaries
MA Jan.7-9, 2019	Jan. 2017 - Dec. 2017: 0.08249 tce/ten thousand yuan 1.386 tce/m ² Jan. 2018 - Nov. 2018: 0.09440 tce/ten thousand yuan 1.383 tce/m ²	Plant locates at No. 18, Zhangjiang Road, Pudong New Area (excluding Shaoxing Project, Jiangyin Project and TSES Project), Shanghai P.R. China, Production main energy use process includes cleaning, oxide diffusion, CVD (Chemical Vapor Deposition), Litho, stripping of photoresist, Dry Etch, CMP (chemical mechanical polisher), Wet Etch, implant, sputter, testing and auxiliary production process including boiler, compressed air supply, ventilation, lighting, heating ventilation air conditioning, process cooling water, Ultra-Pure Water, waste water treatment, and exhaust treatment system as well as subsidiary production process including canteen Jan. 2017 - Dec. 2017: 59667.4104 m ² (Equivalent 8-inch wafer) Jan. 2018 - Nov. 2018: 53990.416 m ² (Equivalent 8-inch wafer)
1 st Sur Jan.6-7, 2020	Dec. 2018 - Nov. 2019: 0.101 tce/ten thousand yuan 1.425 tce/m ²	Plant locates at No. 18, Zhangjiang Road, (excluding Shaoxing Project, Jiangyin Project and TSES Project), China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai City, P.R. China, Production main energy use process includes cleaning, oxide diffusion, CVD (Chemical Vapor Deposition), Litho, stripping of photoresist, Dry Etch, CMP (chemical mechanical polisher), Wet Etch, implant, sputter, testing and auxiliary production process including boiler, compressed air supply, ventilation, lighting, heating ventilation air conditioning, process cooling water, Ultra-Pure Water, waste water treatment, and exhaust treatment system as well as subsidiary production process including canteen. Dec. 2018 - Nov. 2019 52537.460 m ² (Equivalent 8-inch wafer)
2 nd Sur Mar.18-19, 2021	Dec. 2019 - Dec. 2020: 0.107 tce/ten thousand yuan 1.409 tce/m ²	Plant locates at No. 18, Zhangjiang Road, (excluding Shaoxing Project, Jiangyin Project and TSES Project), China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai City, P.R. China, Production main energy use process includes cleaning, oxide diffusion, CVD (Chemical Vapor Deposition), Litho, stripping of photoresist, Dry Etch, CMP (chemical mechanical polisher), Wet Etch, implant, sputter, testing and auxiliary production process including boiler, compressed air supply, ventilation, lighting, heating ventilation air conditioning, process cooling water, Ultra-Pure Water, waste water treatment, and exhaust treatment system as well as subsidiary production process including canteen. Dec. 2019 - Dec. 2020 53008 m ² (Equivalent 8-inch wafer)